

# 酸化物単結晶基板

弊社ではエピタキシャル成長に適した各種酸化物単結晶基板を提供しております。  
 (サファイア、SrTiO<sub>3</sub>、ルチル、LaAlO<sub>3</sub>、NdGaO<sub>3</sub>については個別カタログをご覧ください)

## 【諸性質】

(参考データ)

結晶	MgO	YSZ	LSAT	MgAl <sub>2</sub> O <sub>4</sub>
結晶系	立方晶	立方晶	立方晶	立方晶
結晶構造	NaCl型構造	CaF <sub>2</sub> 型構造	ペロブスカイト構造	スピネル型構造
格子定数	a = 0.4213 nm	a = 0.5139 nm	a = 0.7736 nm	a = 0.8083 nm
融点	2800 °C	2500 °C	1840 °C	2130 °C
密度	3.59 g/cm <sup>3</sup>	6.05 g/cm <sup>3</sup>	6.79 g/cm <sup>3</sup>	3.64 g/cm <sup>3</sup>
熱膨張係数	13.5x10 <sup>-6</sup> /°C	10.3x10 <sup>-6</sup> /°C	10x10 <sup>-6</sup> /°C	7.5x10 <sup>-6</sup> /°C
誘電率	10	27	22	—

## 【標準仕様】

面方位公差	±0.5°
サイズ	10×10×0.5mm, 15×15×0.5mm 外形公差: ±0.1mm, 厚み公差: ±0.05mm
表面粗さ	Ra ≤1.0nm, Rmax ≤5.0nm
平坦度	10×10×0.5mm: ≤λ, 15×15×0.5mm: ≤1.5λ (λ=632.8nm)

(本表は一般的な仕様です。材料や方位によってはこれと異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい)

### MgO

面方位	オリフラ	サイズ*	片面研磨	両面研磨
(100)	(010)	10x10x0.5mm	○	○
"	"	15x15x0.5mm	○	△

### YSZ

Yttria Stabilized Zirconia (Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>≒10mol%)

面方位	オリフラ	サイズ*	片面研磨	両面研磨
(100)	(010)	10x10x0.5mm	○	○
"	"	15x15x0.5mm	○	△
(111)	(110)	10x10x0.5mm	★	○

★: 計画在庫品

○: 標準品

△: 受注生産品

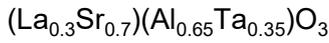
☆計画在庫品: 定期的に生産を管理している仕様になります。

・タイミングによっては在庫がない場合がございます。

・予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

※受注生産品および特殊仕様品は、5枚から承ります。

## LSAT



面方位	オリフラ	サイズ	片面研磨	両面研磨
(100)	(010)	10x10x0.5mm	★	△
〃	〃	15x15x0.5mm	○	△

## MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

スピネル

面方位	オリフラ	サイズ	片面研磨	両面研磨
(100)	(010)	10x10x0.5mm	○	△
(111)	(110)	10x10x0.5mm	△	△

★: 計画在庫品

○: 標準品

△: 受注生産品

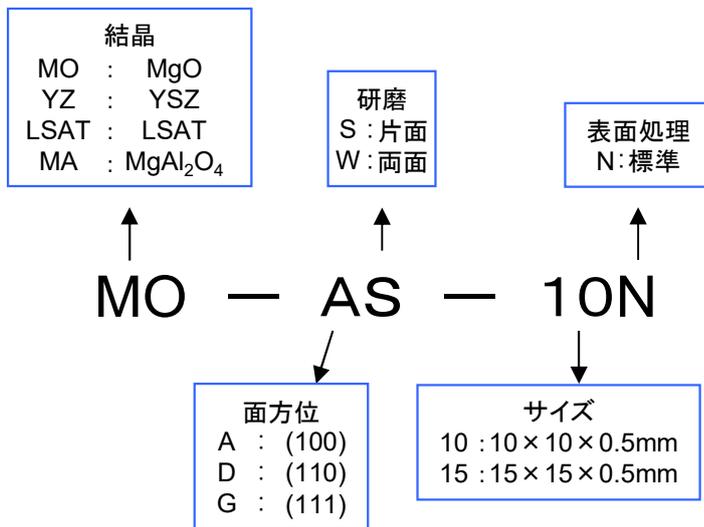
☆ 計画在庫品: 定期的に生産を管理している仕様になります。

・タイミングによっては在庫がない場合がございます。

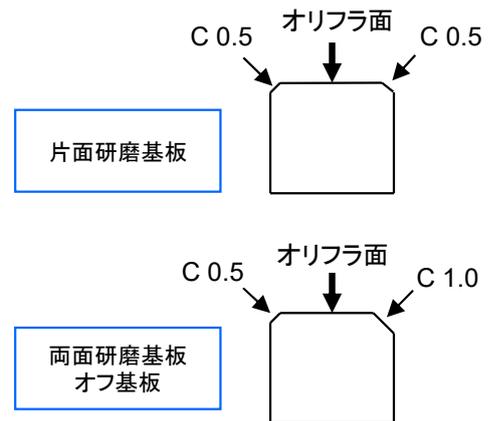
・予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

\* 受注生産品および特殊仕様品は、5枚から承ります。

## 型番



## オリフラ



<外觀検査基準について>

・外周から0.2mm以下、厚みの1/2以下のカケは不問とさせていただきます。

・片面研磨品の裏面キズ、シミは不問とさせていただきます。

お問い合わせは  
**SHINKOSHA Co., Ltd.**

**株式会社 信光社** 営業部  
〒247-0007神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷2-4-1

TEL: 045-892-4393, FAX: 045-892-2986

E-mail: sales@shinkosha.com

URL: <http://www.shinkosha.com/>